IEEE Electron Devices Society (EDS) Kansai Chapter 主催

第14回 関西コロキアム電子デバイスワークショップ

参加費
無料
（事前登録不要）

2013年度IEEE主要ジャーナル・国際会議から関西発の注目論文を選りすぐり、著者自らに解説していただきます

日　時：　2014年11月17日(月) 10:10～17:05
会　場：　大阪工業大学 うめきたナレッジセンター
グランフロント大阪 ナレッジキャピタルタワー C9階
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 TEL: 06-6359-1159
http://www.oit.ac.jp/umekita/index.html
公用語：　日本語

お問合せ先:　IEEE EDS Kansai Chapter Secretary: 前元 利彦 (大阪工業大学; maemoto@ee.oit.ac.jp)

講演プログラム　2014年11月17日（月）　10:10−17:05

I. Power and Compund Semiconductor Devices [10:15 - 11:30]

1. Impact of Epi-Layer Quality on Reliability of GaN/AlGaN/GaN Heterostructure Field-Effect Transistors on Si Substrate [IEEE TED]
Y. Ando (Renesas Electronics Corp.)

2. 4H-SiC MISFETs With 4H-AlN Gate Insulator Isopolytypically Grown on 4H-SiC (1120) [IEEE EDL]
M. Horita (Kyoto Univ.)

3. Breakthrough in Trade-off between Threshold Voltage and Specific On-Resistance of SiC-MOSFETs [ISPSD]
M. Furuhashi (Mitsubishi Electric Corp.)

II. Sensor, Solar Cell, and Emerging Devices [13:00-14:40]

1. High-efficiency Thin and Compact Concentrator Photovoltaics using Micro-solar Cells with Via-holes Sandwiched between Thin Lens-array and Circuit Board [SSDM]
A. Itoh (Panasonic Corp.)

2. Fabrication of Aluminum Oxide Thin Films by Solution-Source Non-Vacuum Process of Mist Chemical Vapor Deposition with Ozone Assistance [SSDM]
T. Uchida (Kyoto Univ.)

3. Fully Printed, Large-scale, High Sensitive Strain Sensor Array for Stress Monitoring of Infrastructures [MEMS]
K. Takei (*Osaka Prefecture Univ.*)

4. Artificial Retina using Poly-Si TFTs –Operation Confirmation of Real-Time Detection– [AMFPD]
M. Kimura (Ryukoku Univ.)

III. CMOS Process, Device, and Circuit [15:00-16:40]

1. Neural Network based on a Three-Terminal Ferroelectric Memristor [VLSI]
Y. Nishitani (Panasonic Corp.)

2. A CMOS Image Sensor Having Stacked Photodiodes for Lensless Observation System of Digital Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) [SSDM]
H. Takehara (NAIST)

3. An Enzymatic Amperometric Glucose Sensor on CMOS Chip using Carbon Ink Electrode and Chromatography Paper [SSDM]
M. Miki (Ritsumeikan Univ.)

4. Nano-device Simulation from an Atomistic View [IEDM]
N. Mori (Osaka Univ.)